

## DC/RF-Labor-Sputteranlage

### Anlagenbeschreibung

Die Laborsputteranlage LA 250 S (vonArdenne Anlagentechnik) besitzt 2 Quellen mit RF und DC-Versorgung (600 und 1500 W), die Möglichkeit zur Reinigung mittels Sputterätzler, BIAS-Spannung am Substrat, Einleitung von 3 externen Gasen, Totaldruckmessung und Plasma-Emmissions-Monitoring. Sie kann daher sehr variabel zur Herstellung metallischer oder keramischer Schichten in monolithischer, gradiert oder auch Mehrlagenanordnung im Bereich bis einigen  $\mu\text{m}$  Gesamtschichtdicke eingesetzt werden.

Probenrotationsvorrichtungen und Planetengetriebe erlauben die Beschichtung mehrerer Proben in einem Run (batch-Betrieb). Der maximal verwendbare Targetdurchmesser beträgt 90mm.

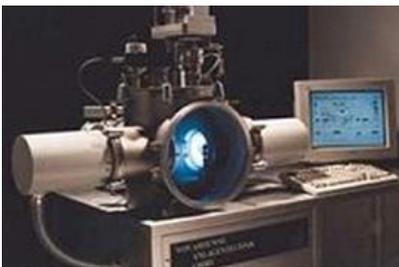
### Anwendung

- Herstellung metallischer oder keramischer Schichten
- Beschichtung mehrerer Proben in einem Run

### Kontakt

- Jörg Brien, DLR-Institut für Werkstoff-Forschung, Tel: +49 2203 601 2541, Fax: +49 2203 696480
- Jochen Krampe, Technologiemarketing, Tel: +49 2203 601 3665, Fax: +49 2203 695689

DC/RF-Labor-Sputteranlage



*Dieses Handout sowie Querverweise zu verwandten Messtechniken und Anlagen finden Sie unter: <http://messtec.dlr.de/link-284-de>.*